

成膜プロセス技術の最前線 開催のお知らせ

講義日程：平成 25 年 12 月 2 日（月）～ 3 日（火）

場 所：産総研つくば中央第 2 事業所 12 棟 第 6 会議室

講義内容	講 師	
成膜基本技術		
コマ1: デバイスプロセスを支える真空技術	山口大学	栗巢 普揮 氏
コマ2: 超臨界プロセス技術	山梨大学	近藤 英一 氏
コマ3: ウェットプロセスのナノ化学	早稲田大学	本間 敬之 氏
コマ4: CVD/ALDプロセス概論	東京大学	霜垣 幸浩 氏
プラズマプロセス技術		
コマ5: プラズマALD技術	Oxford Instruments plc	Larry Leung 氏
コマ6: 最先端プラズマプロセス	名古屋大学	堀 勝 氏
応用技術		
コマ7: 機能性酸化物スパッタ技術	株式会社アルバック	木村 勲 氏
コマ8: ALDゲート絶縁膜技術	物質・材料研究機構	生田目俊秀 氏

日程	9:30	11:00	11:15	12:45	13:45	15:15	15:30	17:00
12月2日（月）		コマ1		コマ2		コマ3		コマ4
12月3日（火）		コマ5		コマ6		コマ7		コマ8

日 程	実習内容	
12/4（水）～6（金） いずれか1日	スパッタ	基本操作と構造の習得
		ユーザーメンテナンス
		スパッタ膜の観察
	蒸着	基本操作と構造の習得
		ユーザーメンテナンス
		蒸着膜の観察
	CVD	基本操作と構造の習得
		ユーザーメンテナンス
		CVD膜の観察
1月下旬～2月下旬	製造現場	品質管理、装置メンテナンス等

薄膜形成の基本から最新技術までを学習すると共に「実習・製造現場実習」によって実際に最前線の技術を習得いただけます。

実習を受講された方には、原則として必ず製造現場実習カリキュラムを受講していただきます。

実 習：全コマを受講された方は、ナノプロセッシング施設における要素技術・プロセスの実習を受けることができます。

製造現場実習：インターンシップ形式の実習です。実際の製造現場で実習を行っていただきます。

◆お問合わせ◆

（独）産業技術総合研究所
ナノエレクトロニクス研究部門 ナノプロセッシング施設
Tel：029-861-3210 E-mail：seed-info-ml@aist.go.jp

<http://www.seed-nt.jp/h25/index.php>

